



## NU-221 プラズマCVD装置

サムコ製 PD-220N

### 登録ファイル

**X** PDL (Process Data Log) ファイル **必須です**

(以下より該当するPDLファイルをダウンロードし、**成膜条件を入力してください**)

<https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/data2.html>



成膜時の基板配置の撮影画像など **必須ではありません**  
(ファイル形式：.jpg, .png, .tiff)



### 添付ファイル



無し

### 【注意事項】

- ・一日に複数のサンプルを作製した場合は複数ファイルを同時に登録することを推奨します。**試料番号を入れるなど後で識別できるファイル名で保存し**、登録ファイルへ一度に登録してください。
- ・サンプルの内容が大幅に異なる場合は、別々に登録（連続登録）を行ってください。（ユーザーの裁量で分け方を決めていただいて構いません）  
連続登録については、データ登録マニュアル[6/8]を参照ください。
- ・**原則、実施日毎の登録をお願いします。**

※ 登録開始を押して構造化が始まると、登録ファイルは追加・編集できません。（追加・編集したい際には、登録済のデータを削除して再度登録を行ってください）



お問い合わせ [hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp](mailto:hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp)

ARIM名古屋大学  
加工・デバイスプロセス分野  
データ登録担当：秦

2024/11/29